

半導体をはじめ、多方面への応用可能な 操作性の良いマスクアライナです。

シリコン、ガラス、セラミック基板等の材料（以下ワーク）上に形成したフォトレジスト等に、所定のパターンを有するフォトマスクを用い、等倍露光によりパターン形成を行う装置となります。マスク上に配置されたアライメントマークと、ワーク上に形成されたアライメントマークとを顕微鏡により観察しながら、手動によりXYθステージを操作してアライメントを行います。

Z軸ステージには、位置読み取りスケールを内蔵しており、ソフトコンタクト露光の他、ギャップ管理によるプロキシミティ露光も行えます。

アライメント後は、顕微鏡を退避させ、上面よりUV光を照射し、露光を行います。露光モードは、積算露光とタイマー露光の選択が可能です。



【各部仕様】

マスクサイズ：□7インチ×t=2.3mm~3.0mm

ワークサイズ：~Φ6インチ

UVランプハウス：インテグレート

照度均一性：<±5.0%

露光光源：UVランプ250W

露光用タイマー：積算光量orタイマ切り換え方式

コンタクト方法：ソフトコンタクト/プロキシミティ

露光ギャップ設定可能範囲：0~1mm

アライメント用ステージ移動量：

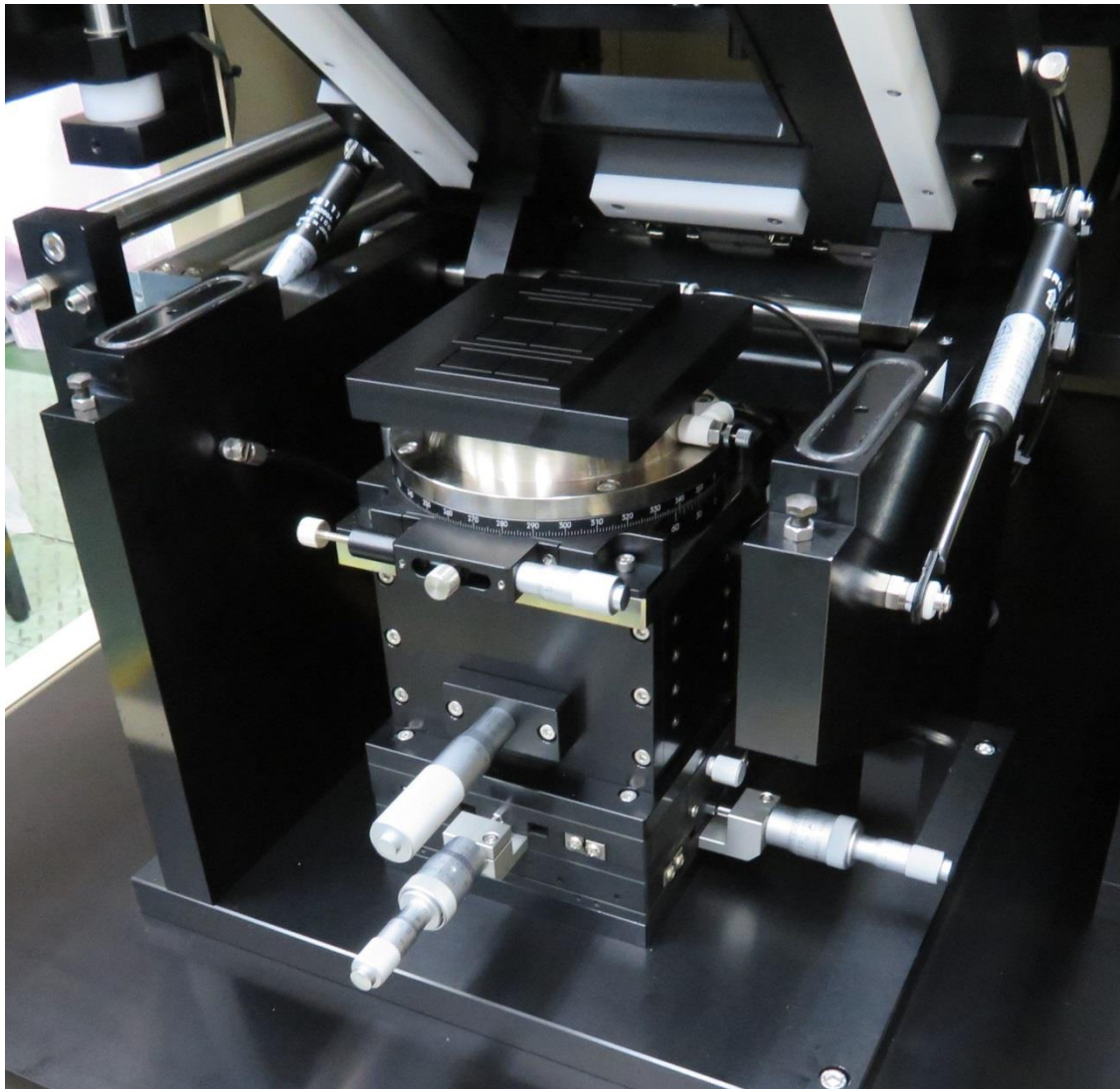
XY	粗動±5mm	微動±0.2mm
Z	10mm	
θ	±5°	

Z軸顕微鏡間距離：X方向 40~200mm

Y方向 センタより±50mm

製品の特長

- 最適な光学系との組み合わせにより、アライメント作業が容易に行えます。
- シリコン・ガラス・フィルムなどの様々な材質、あるいは不定形サイズの基板等にも対応可能です。
- アライメント顕微鏡の対物レンズは高アライメントや膜厚などの用途に応じ、対応致します。



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

製造元



株式会社 昭和サイエンス

〒140-0011
東京都品川区東大井5丁目12番10号（大井朝陽ビル）
TEL (03)5781-3300（代） FAX (03)5463-5001

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.ssvi.co.jp//>